

СОДЕРЖАНИЕ

Том 47, номер 3, 2018

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Влияние дозы экспонирования на стойкость негативного электронного резиста HSQ в процессах плазмохимического и химического травления

А. В. Мяконьких, Н. А. Орликовский, А. Е. Рогожин, А. А. Татаринцев, К. В. Руденко

179

ДИАГНОСТИКА

Гелиевые пузыри в слоях Si(001) после высокодозовой имплантации и термического отжига

А. А. Ломов, А. В. Мяконьких, Ю. М. Чесноков

187

Лазерная методика оценки параметров чувствительности бис к эффектам воздействия отдельных заряженных частиц

А. И. Чумаков

198

Геометрические эффекты в вольт-амперной зависимости крестообразной МДМ-структуры Ni/NiO/Fe

И. В. Маликов, В. А. Березин, Л. А. Фомин, Г. М. Михайлов

205

Магнитно-силовая микроскопия нанопроволок железа и никеля, полученных методом матричного синтеза

Д. А. Бизяев, А. А. Бухараев, Р. И. Хайбуллин, Н. М. Лядов, Д. Л. Загорский, С. А. Бедин, И. М. Долуденко

212

Исследование динамических характеристик высокотемпературных элементов КНИ КМОП СБИС

А. С. Бенедиктов, Н. А. Шелепин, П. В. Игнатов, А. А. Михайлов, А. Г. Потупчик

222

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Расчёт высокочастотной электропроводности тонкого металлического слоя в случае эллипсоидальной поверхности Ферми

И. А. Кузнецова, Д. Н. Романов, А. А. Юшканов

226

Расчет АЧХ МЭМС-микрофона с помощью конечно-элементного моделирования

Д. М. Григорьев, И. В. Годовицын, В. В. Амеличев, С. С. Генералов

238

Расчётно-экспериментальная оценка надёжности глубокосубмикронных КНИ МОП-транзисторов при высоких температурах

А. С. Бенедиктов, Н. А. Шелепин, П. В. Игнатов

244